

**ЭФФЕКТ НЕМОНОТОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ ШУМА  $1/f$   
ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОДСВЕТКИ В Si  
И МОДЕЛЬ ОБЪЕМНОГО ШУМА  $1/f$   
В ПОЛУПРОВОДНИКАХ**

Гук Е. Г., Дьяконова Н. В., Левинштейн М. Е., Румянцев С. Л.

Обнаружен эффект немонотонной зависимости уровня шума  $1/f$  в кремнии от интенсивности подсветки. При температуре  $T \sim 100 \div 150$  К уровень шума с увеличением интенсивности подсветки вначале растет, а затем уменьшается. С дальнейшим увеличением интенсивности уровень шума падает до величины, меньшей, чем темновая. За этот эффект ответственны фотоны с энергией  $\epsilon_f \geq \epsilon_g$  ( $\epsilon_g$  — ширина запрещенной зоны кремния). Эффект максимален при  $\epsilon_f \approx 1.4$  эВ. С повышением температуры эффект ослабевает и при  $T \geq 250$  К не наблюдается.

Эффект объясняется в рамках модели объемного шума  $1/f$ . В модели предполагается, что шум  $1/f$  обусловлен флуктуациями числа носителей на уровнях «хвоста» плотности состояний вблизи края зоны проводимости.

Вследствие важной роли, которую играет кремний в современной электронике, большинство экспериментов по исследованию шума  $1/f$  в полупроводниках выполнено на Si. Однако полученные разными авторами результаты противоречивы (см. соответствующие ссылки в работе [1]). Более того, до настоящего времени отсутствует надежный критерий, который позволил бы для проделанных экспериментов отличить шум  $1/f$ , возникающий вследствие процессов в объеме материала, от шума  $1/f$  поверхностного и (или) контактного происхождения.

В настоящей работе при исследовании низкочастотного шума в Si в области температур  $T \sim 100 \div 150$  К обнаружен эффект немонотонной зависимости уровня шума от интенсивности подсветки. Эффект объясняется в рамках недавно сформулированной теории объемного шума  $1/f$  в полупроводниках. Сопоставление теории и эксперимента дает возможность установить объемную природу наблюдавшегося шума  $1/f$  и сформулировать гипотезу о природе шума  $1/f$  в кремнии.

Исследовались образцы Si двух типов. Образцы первого типа изготавливались из  $n$ -Si, полученного методом бесстительной зонной плавки, с удельным сопротивлением  $\rho \approx 200 \div 300$  Ом·см ( $n_0 \approx 2 \cdot 10^{13}$  см $^{-3}$ ), плотностью дислокаций  $\approx 3 \cdot 10^4$  см $^{-2}$ , подвижностью электронов  $\mu_n \approx 0.12$  м $^2$ /В·с при 300 К и  $\mu_n \approx 1.8$  м $^2$ /В·с при 77 К.

Образцы второго типа изготавливались из нейтронно-легированного кремния. Кремний был получен облучением исходного слитка нейтронами в реакторе типа ВВР-ц при отношении плотности тепловых нейтронов к плотности быстрых  $\sim 20 : 1$  и полной дозе  $\sim 10^{16} \div 10^{17}$  н/см $^2$ . Режим отжига варьировался в широких пределах. Во всех случаях после отжига образцы имели  $n$ -тип проводимости и удельное сопротивление  $\rho \sim 200 \div 300$  Ом·см. При отжиге в течение 30–60 мин при температуре 800 °C электрофизические свойства получаемых образцов — концентрация и подвижность при 300 и 77 К были практически теми же, что и для образцов первого типа. Снижение температуры и (или) уменьшение времени отжига приводили к уменьшению подвижности электронов, в особенности в области пониженных температур ( $T \leq 200$  К).

Форма и размеры образцов, а также способ изготовления омических контактов аналогичны описанным в работе [1]. Пластины разделялись на образцы раскалыванием, так как опыт показал, что при таком методе разделения уровень поверхностного шума меньше, чем при использованной в [1] лазерной резке.

Для экспериментов отбирались образцы, уровень шума  $1/f$  в которых при 300 К характеризовался величиной параметра Хоуге [2]  $\alpha \leq 5 \cdot 10^{-4}$  и слабо зависел от подсветки. (Как показано в работе [1], заметное изменение шума  $1/f$

под влиянием подсветки при 300 К может свидетельствовать о поверхностной природе наблюдаемого шума).

На рис. 1 показаны зависимости относительной спектральной плотности шума от частоты при температуре  $T \approx 120$  К для трех различных образцов в темноте (сплошные кривые) и для трех различных интенсивностей подсветки. Образец 1S изготовлен из Si, полученного бесстигельной зонной плавкой. Отношение подвижности электронов при 77 К  $\mu_{77}$  к величине подвижности при комнатной температуре  $\mu_{300}$ , которое часто используется для оценки качества материала [3], для этого образца составляет  $\mu_{77}/\mu_{300} \approx 12.5$ . Величина  $\alpha$  при комнатной температуре  $\alpha_{300} \approx 3 \cdot 10^{-4}$ .

Образец 2H изготовлен из нейтронно-легированного кремния, прошедшего отжиг в течение 30 мин при 800 °C. Для этого образца  $\mu_{77}/\mu_{300} \approx 11.5$ ,  $\alpha_{300} \approx 2.8 \cdot 10^{-4}$ .

Образец H-1 также изготовлен из нейтронно-легированного кремния.

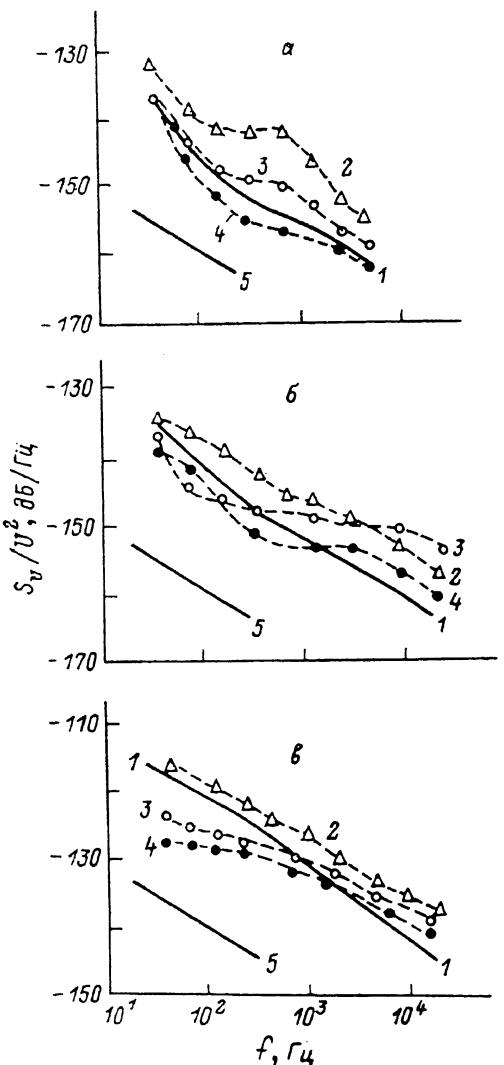


Рис. 1. Зависимость относительной спектральной плотности шума от частоты для трех различных образцов Si.

Образцы: а — 1S, б — 2H, в — H-1. Т, К: а — 120, б — 128, в — 121. Сплошные кривые 1 — темновые зависимости, штриховые 2—5 — при подсветке от лампы накаливания номинальной мощностью 100 Вт. Потребляемая мощность, Вт: 2 — 2, 3 — 12, 4 — 100. 5 — наклон  $1/f$ .

Однако режим отжига был существенно иным: образец отжигался при 700 °C в течение 1 ч. Для образца H-1  $\mu_{77}/\mu_{300} \approx 4.2$ ,  $\alpha_{300} \approx 4.3 \cdot 10^{-3}$ .

Из рис. 1, а—в видно, что для всех трех образцов темновые зависимости  $S_U/U^2$  от частоты анализа представляют собой обычную суперпозицию шума типа  $1/f$  и отдельных, довольно слабо проявляющихся лоренцианов [4]. Уровни шума в образцах 1S и 2H близки, уровень шума в образце H-1 приблизительно на 20 дБ выше.

Кривые 2 на рис. 1, а—в соответствуют частотным зависимостям  $S_U/U^2$  в условиях, когда образцы освещались очень слабым светом лампы накаливания при потреблении мощности лампой  $\sim 0.02$  от номинального значения, равного 100 Вт. При столь слабом освещении избыточная фотопроводимость  $\Delta\sigma/\sigma_0$  не превышала  $\sim 10^{-5}$ . Тем не менее видно, что под действием этого слабого

света уровень шума существенно (на 2–6 дБ) возрастает во всем диапазоне частот анализа (20 Гц–20 кГц).

Кривые 3 сняты при более интенсивном освещении, когда мощность, потребляемая лампой накаливания, составляла ~0.12 от номинальной. Величина  $\Delta \sigma/\sigma_0$  при этом уровне освещения составляла ~ $10^{-3}$ . Видно, что уровень шума понизился. Особенно это заметно на низких частотах анализа, где шум снижается до значений, меньших темнового (образцы 2Н и Н-1). На верхних частотах анализа снижение шума не столь существенно и уровень его остается выше темнового.

Кривые 4 сняты при освещении образцов в режиме потребления лампой накаливания номинальной мощности. Величина  $\Delta \sigma/\sigma_0$  составляет при этом ~ $10^{-1}$ .

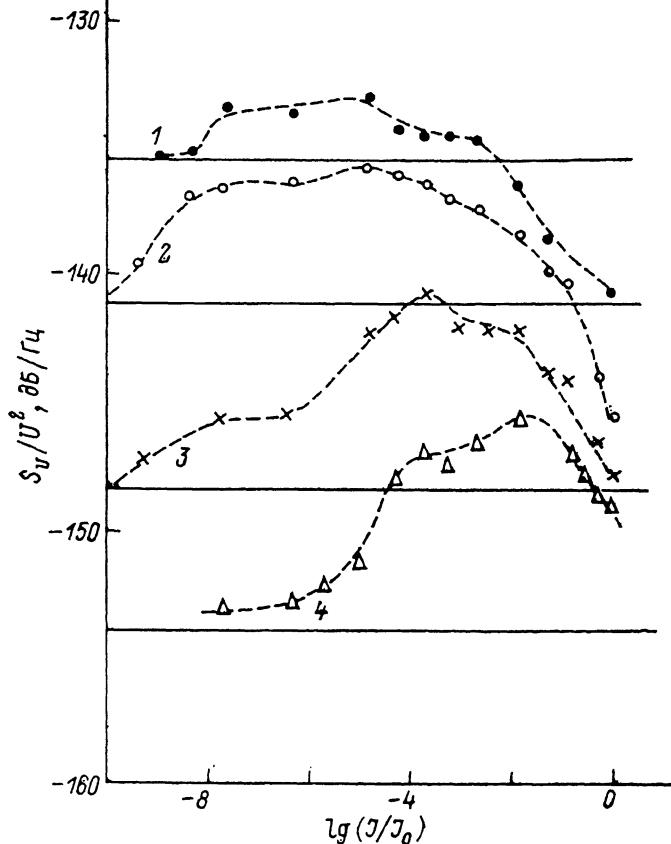


Рис. 2. Зависимость относительной спектральной плотности шума от относительной интенсивности подсветки для различных частот анализа.

Частота, Гц: 1 — 40, 2 — 80, 3 — 320, 4 — 1280. Сплошные горизонтальные прямые — уровень темнового шума. Образец 3Н;  $T=124$  К.

Видно, что увеличение интенсивности подсветки приводит к дальнейшему уменьшению уровня шума, в особенности на низких частотах.

На рис. 2 представлены зависимости относительной спектральной плотности шума  $S_U/U^2$  от относительной интенсивности подсветки для фиксированных частот анализа. Образец 3Н изготовлен из той же пластины, что и образец 2Н. Зависимости сняты при освещении образца лампой накаливания при номинальной потребляемой ею мощности. Непосредственное освещение соответствует интенсивности света  $J_0$ . Свет ослаблялся с помощью калиброванного набора нейтральных фильтров. Из рисунка видно, что заметное влияние на шум оказывает даже световой поток лампы, ослабленный в ~ $10^8$ – $10^9$  раз. По мере увеличения интенсивности подсветки шум на данной частоте возрастает, достигает максимума и затем монотонно уменьшается. Чем выше частота анализа, тем

большая интенсивность света необходима, чтобы достичнуть максимума на зависимости  $S_U(J)$ .

На рис. 3 для образца 3Н при температуре 124 К, частоте анализа 320 Гц и интенсивности света на входе монохроматора  $\sim 10^{-2} J_0$  показана зависимость стационарной фотопроводимости (кривая 1) и плотности шума (кривая 2) от энергии фотонов падающего на образец света. Из рисунка видно, что максимальная фоточувствительность и проводимости, и шума достигается при одной и той же энергии фотонов  $\epsilon_\phi \approx 1.4$  эВ, которой соответствует глубина поглощения в Si  $\sim 20$  мкм. Совпадение максимумов на зависимостях  $\Delta\sigma/\sigma_0(\epsilon_\phi)$  и  $S_U(\epsilon_\phi)$  является доводом в пользу объемной природы наблюдающихся эффектов.

Действительно, в работе [1], где изучалось влияние освещения на поверхностную компоненту шума  $1/f$  в кремнии, максимальная фоточувствительность проводимости наблюдалась при энергии фотонов  $\epsilon_\phi \approx 1.4$  эВ, а максимальная фоточувствительность шума — при  $\epsilon_\phi \approx 1.6$  эВ (характерная глубина проникно-

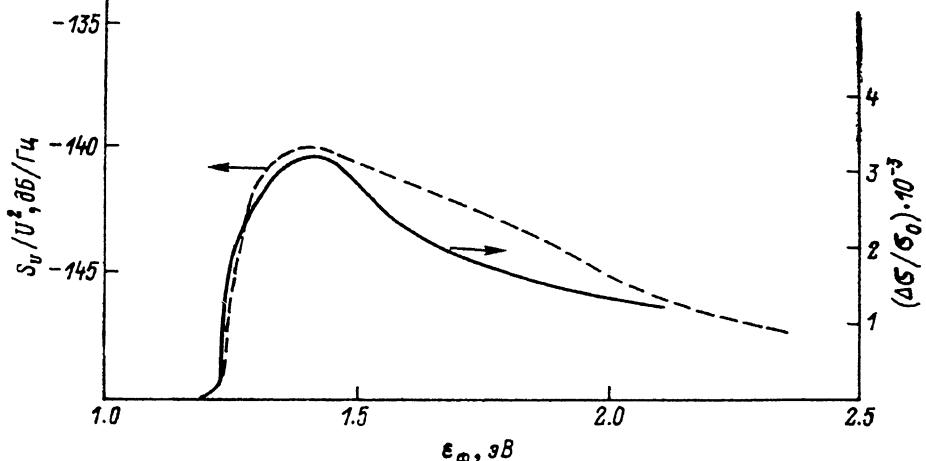


Рис. 3. Зависимость относительной фотопроводимости (сплошная кривая) и относительной спектральной плотности шума (штриховая) от энергии фотонов падающего на образец света.

Образец 3Н;  $T=124$  К. Частота анализа 320 Гц.

вения поглощения  $\sim 5$  мкм). С другой стороны, в GaAs, где вывод об объемной природе шума  $1/f$  был сделан на основе независимых измерений в условиях сильного геометрического магнитосопротивления, максимуму фотопроводимости и максимальной фоточувствительности шума соответствовала одна и та же энергия фотонов  $\epsilon_\phi$  [5, 6].

Покажем, что описанный выше эффект перестройки низкочастотного шума светом качественно полностью описывается в рамках модели объемного шума  $1/f$  в полупроводниках, предложенной недавно в работе [7]. В модели предполагается, что шум  $1/f$  обусловлен флуктуациями числа носителей на уровнях «хвоста» плотности состояний вблизи зоны проводимости. Такие хвосты возникают вследствие различного рода несовершенств кристаллической решетки и всегда присутствуют в реальных полупроводниках. Считается, что плотность состояний в хвосте  $\rho(\epsilon)$  экспоненциально спадает в глубь запрещенной зоны:

$$\rho(\epsilon) = \rho(0) \exp(-\epsilon/\epsilon_0), \quad (1)$$

где  $\rho(0)$  — плотность состояний при  $\epsilon=0$  (энергия отсчитывается от края зоны проводимости),  $\epsilon_0$  — постоянная, характеризующая скорость спада плотности состояний.

В варианте модели, который будет здесь использован для интерпретации экспериментальных результатов, предполагаем, следуя многофононной модели захвата, что постоянная времени захвата экспоненциально растет с энергией уровней в хвосте:

$$\tau_0(\epsilon) = \tau_0(0) \exp(\epsilon/\epsilon_1) \equiv \tau_{00} \exp(\epsilon/\epsilon_1), \quad (2)$$

где  $\tau_{00}$  — постоянная времени для уровней при  $\varepsilon=0$ ,  $\varepsilon_1$  — постоянная, характеризующая уменьшение сечения захвата с ростом энергии  $\varepsilon$ .

В соответствии с экспериментальной ситуацией принимается, что в кристалле помимо «хвоста» существует мелкий донорный уровень с концентрацией  $N_d$ , полностью ионизованный при температурах измерений. Величина  $N_d$  много больше концентрации всех других уровней в запрещенной зоне.

Как показано в [7], флуктуации числа носителей на уровнях хвоста плотности состояний в такой модели приводят к возникновению шума типа  $1/f$ . При условии

$$\nu = \frac{kT}{\varepsilon_1} - \frac{kT}{\varepsilon_0} > 1, \quad (3)$$

т. е. в случае, когда постоянная времени  $\tau_0(\varepsilon)$  растет с энергией быстрее, чем падает плотность состояний  $\rho(\varepsilon)$ , и температура относительна велика, в области низких частот ( $\omega\tau_F \ll 1$ ) спектральная плотность шума неограниченно возрастает с уменьшением частоты анализа. Величина  $\tau_F = \tau_{00} \exp[\varepsilon_F/\varepsilon_1]$ , где  $\varepsilon_F$  — энергия Ферми

$$\varepsilon_F = kT \ln(N_e/N_d), \quad (4)$$

$N_e$  — эффективная плотность состояний в зоне проводимости.

Если в результате освещения в образце появляются дырки, то они захватываются на уровнях, образующие хвост плотности состояний. При этом изменяется степень заполнения уровней  $f$ , время релаксации  $\tau$  и соответственно уровень и характерная частота шума, генерируемого уровнями хвоста с энергией  $\varepsilon$ . Как показано в [7], относительная спектральная плотность шума при освещении определяется в такой модели выражением

$$\frac{S_n}{n^2} = \frac{S_U}{U^2} = \frac{4N_{00}\tau_{00}}{N_d^2 V} \int_0^\infty f^{*2} (1-f^*) \frac{e^{x(a-1)}}{1+(ze^{axf^*})^2} dx = \frac{4N_{00}\tau_{00}}{N_d^2 V} I(z), \quad (5)$$

где  $N_{00} = \int_0^\infty \rho(\varepsilon) d\varepsilon = \rho(0)\varepsilon_0$  — полная концентрация уровней в хвосте,  $V$  — объем образца,  $x = \varepsilon/\varepsilon_0$ ,  $a = \varepsilon_0/\varepsilon_1$ ,  $z = \omega\tau_{00}$ ,

$$f^* = \frac{1}{\frac{N_e}{N_d} e^{-x/t} + 1 + \beta e^{ax}} \quad (6)$$

— функция заполнения уровней хвоста с учетом захваченных на уровнях дырок,  $t = kT/\varepsilon_0$  — безразмерная температура.

Параметр  $\beta = \tau_{00}/\tau_p$  зависит от степени освещенности образца. В модели принимается, что вероятность захвата дырки уровнями хвоста (в отличие от вероятности захвата электрона) не зависит от энергии  $\varepsilon$ . При этом  $\tau_p = (\eta p)^{-1}$ , где  $\eta$  — вероятность захвата дырки на уровне,  $p$  — концентрация свободных дырок. Следует заметить, что на практике концентрация свободных дырок при заданной интенсивности света определяется, по-видимому, не плотностью уровней в хвосте, а концентрацией эффективных рекомбинационных уровней с большим сечением захвата дырок [8]. При  $\beta = 0$  (т. е. в отсутствие дырок) выражение (6) для величины  $f^*$  переходит в стандартную функцию заполнения уровня с энергией  $\varepsilon$ , а интеграл (5) описывает темновую спектральную плотность шума, определяемую флуктуациями числа носителей на уровнях хвоста.

На рис. 4 показаны рассчитанные численно при различных значениях параметра  $\beta$  зависимости  $I(z)$  (в безразмерных единицах), характеризующие зависимости относительной спектральной плотности шума от частоты анализа при различных уровнях освещенности в соответствии с (5). Увеличению параметра  $\beta$  соответствует увеличение интенсивности света. При расчете использовались следующие значения параметров:  $\varepsilon_0 = 0.03$  эВ,  $a = \varepsilon_0/\varepsilon_1 = 6$ ,  $N_d = 2 \cdot 10^{13}$  см<sup>-3</sup>,  $t = kT/\varepsilon_0 = 0.35$  (что соответствует температуре 122 К),  $N_e/N_d$  (при 122 К) =  $= 3.5 \cdot 10^6$ .

Видно, что темновой шум ( $\beta=0$ ) имеет вид зависимости типа  $1/f$  во всем рассчитанном диапазоне частот  $\omega\tau_{00}$ . Отметим, что чрезвычайно малые значения  $\omega\tau_{00} \sim 10^{-20} - 10^{-12}$  связаны с выбором в качестве временного масштаба очень малого времени  $\tau_{00}$  — времени захвата на уровне хвоста, расположенные в непосредственной близости от края зоны проводимости. Преимущество такого выбора состоит в том, что  $\tau_{00}$  не зависит от температуры. Физически более оправдан выбор в качестве временного масштаба времени  $\tau_F$  — постоянной захвата на уровне Ферми (нижняя шкала на рис. 4). Однако недостатком такого масштаба является сильная зависимость величины  $\tau_F$  от температуры.<sup>1</sup>

При самом низком уровне освещения ( $\beta=10^{-26}$ ) шум возрастает везде, за исключением наиболее высоких частот. По мере увеличения  $\beta$  шум на низких частотах уменьшается: при  $\beta \geq 10^{-15}$  на низких частотах он становится меньше уровня темнового шума. Налицо качественное согласие между эксперимен-

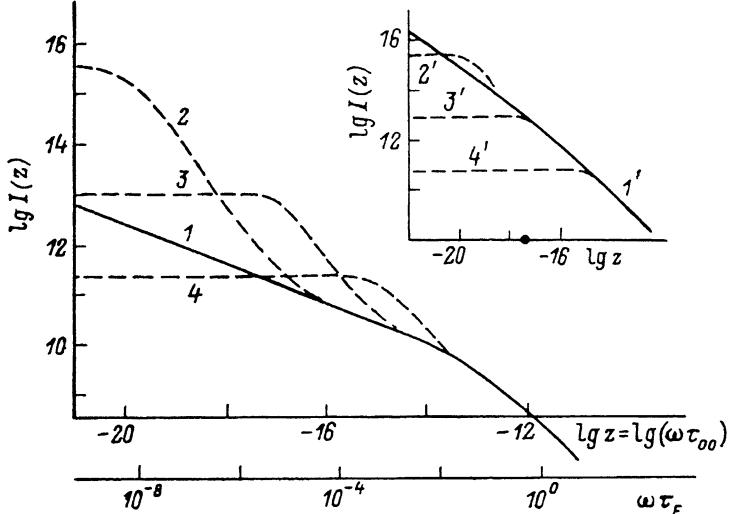


Рис. 4. Расчетные величины  $I(z)$ , характеризующие в безразмерных единицах зависимость уровня шума от частоты анализа при различных значениях параметра  $\beta$ .

$\beta: 1 - 0, 2 - 10^{-10}, 3 - 10^{-17}, 4 - 10^{-15}; t=0.35$ . На вставке — те же зависимости при  $t=0.5$ ; точка —  $\omega\tau_F = 1$ .

тально наблюдающимися зависимостями (рис. 1) и рассчитанными кривыми. Это согласие становится более очевидным, если представить показанные на рис. 4 результаты в виде зависимости относительной спектральной плотности шума от  $\beta$  для различных частот анализа  $\omega\tau_{00}$  (рис. 5) и сопоставить зависимости, показанные на рис. 2 и 5. Видно, что и для теоретических, и для экспериментальных зависимостей шум на данной частоте при увеличении интенсивности подсветки возрастает, достигает максимума и затем монотонно уменьшается. Чем выше частота анализа, тем большая интенсивность подсветки необходима, для того чтобы достигнуть максимума на зависимости  $I(\beta)$ .

В рамках использованной здесь (и подробно описанной в работе [7]) модели объемного шума  $1/f$  полученные результаты интерпретируются следующим образом.

Как уже отмечалось, за возникновение участка шума  $1/f$  в рассматриваемом варианте модели ответственны уровни хвоста плотности состояний, лежащие ниже уровня Ферми (условие  $\omega\tau_F \ll 1$ ). В отсутствие дырок (в темноте) вероятность заполнения этих уровней близка к 1. Постоянная времени обмена электронами  $\tau$  между зоной проводимости и уровнями с энергией  $\epsilon$  практически равна  $\tau_0$  и определяется уравнением (2).

<sup>1</sup> Это замечание относится также и к величинам  $\beta$ . Физически более оправданно сравнивать величину  $\tau_p$  не с  $\tau_{00}$ , а с  $\tau_F$  и пользоваться параметром  $\beta^* = \tau_F/\tau_p$ . В этом случае характерные величины  $\beta^*$  для рассматриваемого эффекта лежат в диапазоне от  $\sim 10^{-8}$  до  $\sim 10^{-3}$ . Величина  $\beta^*$ , однако, сильно зависит от температуры.

Появляющиеся в результате освещения дырки захватываются на уровнях хвоста с вероятностью, не зависящей от энергии  $\epsilon$ . Однако в условиях стационарного освещения степень заполнения уровней очень сильно зависит от  $\epsilon$ , поскольку время захвата электронов на освободившиеся места  $\tau_0$  экспоненциально зависит от энергии [см. выражение (2)]. Действительно, из уравнения (6) видно, что свет слабо влияет на степень заполнения уровней при  $\beta e^{\alpha x} = \beta e^{\epsilon/\epsilon_1} \ll 1$ . В этом случае величина  $f^*$  близка к  $f$ . В противоположном предельном случае  $\beta e^{\alpha x} \gg 1$  функция заполнения  $f^*$  экспоненциально мала. Условию  $\beta e^{\alpha x} \sim 1$  отвечают характерные значения энергии  $\epsilon_x \sim \epsilon_1 \ln(1/\beta)$  или в соответствии с (2) характерные значения  $\tau_{0x} \sim \tau_{00}/\beta$ .

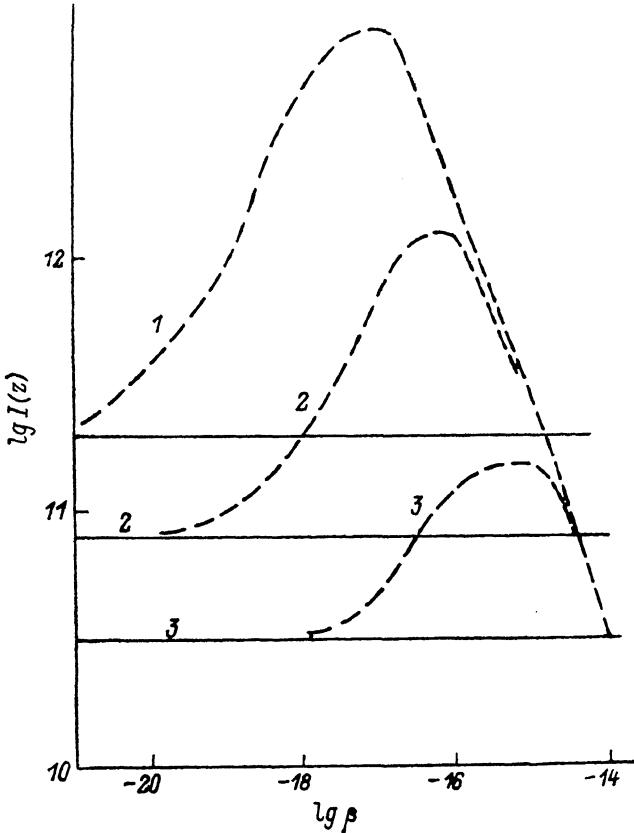


Рис. 5. Расчетные величины  $I(\beta)$  в безразмерных единицах, характеризующие зависимости шума на данной частоте от уровня освещенности (ср. с рис. 2).

Сплошные горизонтальные прямые — уровни темнового шума.  $\lg z = \lg(\omega \tau_{00})$ : 1 — -17, 2 — -16, 3 — -15.

Для уровней с энергией  $\epsilon < \epsilon_x$  освещение практически не меняет степень заполнения. Этим значениям энергии соответствуют времена релаксации  $\tau_0(\epsilon) < \tau_{0x}$ . Соответственно следует ожидать, что на относительно высоких частотах анализа  $\omega \gg 1/\tau_{0x}$  уровень шума практически не изменится.

Уровни с энергией  $\epsilon > \epsilon_x$  при освещении практически пусты и не дают вклада в шум. Поэтому следует ожидать, что на низких частотах анализа  $\omega \gg 1/\tau_{0x}$  спектральная плотность шума будет частотно независимой.

В области промежуточных значений энергии  $\epsilon \sim \epsilon_x$ , т. е. в области частот анализа, соответствующих условию  $\omega \tau_{0x} \sim 1$  (или  $\omega \tau_{00} \sim \beta$ ), захваченные на уровнях хвоста дырки уменьшают степень заполнения, приближая ее к значению  $f^* \sim 2/3$ , при котором уровень шума максимальен.

Из рис. 4 видно, что такая качественная аналитическая оценка хорошо согласуется с результатами численных расчетов (кривые 2—4).

Из рис. 4 и 5 видно, что чем выше частота анализа  $\omega$ , т. е. чем ближе ее значение к критической величине  $\omega_F = 1/\tau_F$ , тем меньше максимально возможное

увеличение шума за счет освещения. Для  $\omega > \omega_F$  увеличение шума за счет появления в образце дырок вообще невозможно, поскольку для уровней с энергией  $\epsilon < \epsilon_F$ , отвечающих за шум в области частот  $\omega > \omega_F$ , степень заполнения меньше 0.5 уже в темноте. Поэтому захват дырок на эти уровни способен лишь уменьшать уровень шума при  $\omega > \omega_F$ .

С увеличением температуры уровень Ферми движется в глубь запрещенной зоны. Значение  $\epsilon_F$  растет. С ростом  $\epsilon_F$  экспоненциально возрастает значение  $\tau_F$  и соответственно значение  $\omega_F = 1/\tau_F$  экспоненциально уменьшается. Таким образом, с увеличением температуры частотный диапазон, в котором может наблюдаться эффект немонотонной зависимости уровня шума от интенсивности подсветки, быстро смещается в область все более низких частот.

При наблюдении шумового спектра в фиксированном диапазоне частот этот эффект с ростом температуры должен постепенно подавляться и полностью исчезать, когда значение  $\omega_F$  станет порядка нижней частоты наблюдения.

Эти качественные соображения полностью подтверждаются результатами численных расчетов (см. вставку на рис. 4). На вставке показаны зависимости  $I(z)$ , рассчитанные для тех же параметров образца и тех же значений  $\beta$ , что и соответствующие зависимости на рис. 4, но для более высокой температуры  $t=0.5$ . Видно, что относительно небольшое изменение температуры привело к уменьшению частоты  $\omega_F$  более чем на 5 порядков. Эффект немонотонной зависимости шума от интенсивности подсветки выражен значительно слабее, а в области верхних частот анализа, соответствующих значениям  $z \geq 10^{-17}$ , полностью подавлен. Таким образом, естественно объясняется экспериментально наблюдающееся исчезновение эффекта при повышении температуры.

Из сопоставления теоретических и экспериментальных зависимостей можно сделать вывод о том, что модель объемного шума  $1/f$ , сформулированная в работе [7] и позволившая ранее объяснить влияние света на шум  $1/f$  в GaAs, позволяет качественно объяснить и все основные особенности эффекта немонотонной зависимости шума  $1/f$  в Si от интенсивности подсветки.

Авторы искренне признательны М. И. Дьяконову за ценные замечания.

#### Список литературы

- [1] Гук Е. Г., Дьяконова Н. В., Левинштейн М. Е. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 6. С. 1120—1122.
- [2] Hooge F. N., Kleinpenning T. G. M., Vandamme L. K. J. // Rep. Prog. Phys. 1981. V. 44. N 5. P. 480—532.
- [3] Зи С. Физика полупроводниковых приборов. Т. 1. М., 1984. 455 с.
- [4] Kleinpenning T. G. M. // Physica. 1982. V. 113B. P. 189—194.
- [5] Левинштейн М. Е., Румянцев С. Л. // ФТП. 1983. Т. 17. В. 10. С. 1830—1834.
- [6] Дьяконова Н. В., Левинштейн М. Е., Румянцев С. Л. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 6. С. 1049—1052.
- [7] Дьяконова Н. В., Левинштейн М. Е. // ФТП. 1989. Т. 23. В. 2. С. 283—291.
- [8] Ботнарюк В. М., Жиляев Ю. В., Кечек А. Г., Кузнецов Н. И., Лебедев А. А., Шульга М. И. // Письма ЖТФ. 1988. Т. 14. В. 2. С. 181—185.

Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе АН СССР  
Ленинград

Получена 3.10.1989  
Принята к печати 2.01.1990